

2026年3月4日
株式会社ニューフレアテクノロジー

半導体露光関連技術の国際会議 「SPIE Advanced Lithography + Patterning」に参加

ニューフレアテクノロジー(NFT)は、2026年2月22日から26日まで米国カリフォルニア州サンノゼ市で開催された「SPIE Advanced Lithography + Patterning」に参加しました。

本学会は、光学やフォトニクスの分野における国際学会であるSPIE(The International Society for Optical Engineering, 国際光工学会)が毎年開催するもので、今回もウェハ露光やフォトマスク製作に関して幅広い報告が行われました。

NFTは、マルチ電子ビームマスク描画装置に関する最新の開発成果について3件の発表(うち1件は共著者としての発表)を行っています。

<SPIE Advanced Lithography + Patterning 2026でのNFT単独の発表論文>

Paper 13982-17

MBM-4000: Advanced features and applications (Invited Paper)

Presenter/Author: Yuji Fujiwara

Authors: Hiroshi Matsumoto, Jumpei Yasuda, Kenichi Yasui, Hayato Kimura,
Yoshinori Kojima

NuFlare Technology, Inc. (Japan)

Paper 13981-114

Analysis of factors affecting pattern fidelity evaluation using sine wave patterns in electron multi-beam mask writing

Presenter/Author: Makoto Kawano

Authors: Shinichi Sasaki, Hikari Ogawa, Aki Mukai, Tianyue Zhou, Takuma Abe,
Yoshiyuki Negishi, Hideki Matsui, Yoshinori Kojima

NuFlare Technology, Inc. (Japan)

以上